## REVIEW

# 基礎から学ぶマススペクトロメトリー/質量分析の源流 第8回 エレクトロスプレーの基礎

## Fundamentals of Mass Spectrometry —Fundamentals of Electrospray—

## 平岡賢三 Kenzo HIRAOKA

山梨大学クリーンエネルギー研究センター Clean Energy Research Center, University of Yamanashi, Kofu, YAMANASHI, JAPAN

Electrospray is an ultimate phenomenon that occurs when the liquid is exposed to the high electric field. In order to fully exploit electrospray for the analytical science and technology, it is mandatory to understand the mechanisms for the formation of charged droplets and the following formation of gas phase ions. This article will explain the basic aspects of electrospray from various points of view. The contents are as follows: (i) electrospray ionization (ESI) is based on electrochemical reactions, (ii) what is the Taylor cone? (iii) disintegration of charged liquid droplets, (iv) mechanism for the formation of gas-phase ions from the charged liquid droplets, (v) effect of surface tension of liquid on electrospray, (vi) positive- and negative-mode of ESI, (vii) suppression effect by the presence of salts, (viii) down-sizing of electrospray, ESI→nanoESI→Probe ESI, (ix) field desorption, (x) field ionization, (xi) formation of multiple-charge ions, (xii) application of electrospray.

(Received February 3, 2010; Accepted February 3, 2010)

#### 1. エレクトロスプレー序説

エレクトロスプレーの略語として ES (electrospray), あるいは ESI (electrospray ionization) がよく使われる. 筆者は ESI を用いることにしている.それは,エレクトロ スプレーという現象が,過剰電荷を液体に供給(注入)す る電気化学反応(正イオンモードでは酸化反応,負イオン モードでは還元反応)に基づくからである.エレクトロス プレーを電池に見立てると,大気を介して,数kVの電位 差が与えられた二つの電極,つまり金属キャピラリーと対 向電極が相対しており,キャピラリーから流出した液体が 酸化あるいは還元されて液体が同符号の過剰イオンで帯電 し,これが対極に向かって飛んで電流が流れる,というイ メージである (Fig. 1).キャピラリーはいわば"半電池"と して働く.電気化学反応によって液体へ過剰イオンが供給 されて,これがペプチドやタンパク質などの多価イオンの 生成につながる.

エレクトロスプレーという現象は1700年初頭から知ら

れていた. それから約 300 年が経った 2002 年に, Fenn がエレクトロスプレーに関する研究でノーベル化学賞を受 賞した. この数百年の間にエレクトロスプレーという現象 が原理的にすべて明らかにされたかといえば, 実はそうで はなく,未解明の現象が多く残されている. この点で, ESI は大きな可能性を秘めたたいへん魅力的な現象なのであ る. この章では, エレクトロスプレーという現象がいかに 興味深いものであるかを解説する.

#### 2. エレクトロスプレーは電気化学反応に基づく

エレクトロスプレーという言葉が定着しているが、この 現象をより厳密に表現するのが "electrohydrodynamic atomization" あるいは "electrohydrodynamic emission" という言葉である.この英語の直訳は "電気流体噴霧" と なろうか.

まず電場 E について考える. 電場 E は,電位差 V が印 加されている空間に生じる. たとえば,エレクトロスプ レーに使う金属キャピラリーに、その対極 (たとえば質量 分析計のイオンサンプリングオリフィス)に対して +3 kV の電位差を与えた場合、キャピラリーと対極間に電場 が生じる.金属キャピラリーは電気伝導体なので、金属 キャピラリーの電位 (ポテンシャル) はどこも同じ +3 kV である.しかし、キャピラリーの電場は場所によって 異なり、大きな曲率をもつ尖った部分ほど、大きな電場が

Correspondence to: Kenzo HIRAOKA, *Clean Energy Research Center, University of Yamanashi, 4–3–11 Takeda, Kofu, Yamanashi 400–8511, JAPAN*, e-mail: hiraoka@yamanashi. ac.jp

平岡賢三,山梨大学クリーンエネルギー研究センター,**〒**400-8511 山梨県甲府市武田 4-3-11

生じる. 電位 V にある種々の形状をもつ導体表面の電場 E は, 球体, 針, 刃, ワイヤーなどの曲率半径をrで表す と, 以下の式で与えられる(d: 対極までの距離).

$$E = K \times (V/r) \tag{1}$$

ここで

球体: K=1針電極:  $K=2/\ln (2d/r)$  (r. 針の先端部の曲率半径) 鋭利な刃:  $K=1/(2d/r)^{1/2}$  (r. 刃のエッジの曲率半径) ワイヤー:  $K=1/\ln (d/r)$  (r. ワイヤーの半径)

エレクトロスプレーではキャピラリーが用いられるので, この場合には,

$$E = 2V/[r\ln(2d/r)] \tag{2}$$

となる. この式から, キャピラリーの先端が鋭い (r が小さい) ほど, また対極との距離 d が近いほど, キャピラリー 先端の電場 E が強くなることがわかる.

ここで,大学の初等電磁気学で学んだ Gauss の法則を 思い出そう<sup>1)</sup>.

$$\Phi = \int E \cdot dA = q_{\rm in} / \varepsilon_0 \tag{3}$$

ここで、 $\phi$  は任意の閉曲面を通過する正味の電束、E は閉曲面の任意の点における電場、 $q_{in}$  は閉曲面内部の正味の 電荷、 $\epsilon_0$  は真空の誘電率、を表す.式(3)をわかりやすく 表現すれば、正味の過剰電荷  $q_{in}$  が存在する場合にのみ電 場が生じるということである.ここで、金属導体表面に存 在する過剰電荷の表面電荷密度を $\sigma$  (C/m<sup>2</sup>) とすると、そ の面上の電場強度 E が以下の式で与えられることが式(3) から容易に導かれる.

$$E = \sigma / \varepsilon_0 \tag{4}$$

式 (4) から,表面電荷密度  $\sigma$  と電場 E は比例関係にあるこ と,つまり,電場 E が生じている金属表面には必ず過剰電 荷(表面電荷密度  $\sigma$ )が存在する,という相関関係がある ことがわかる.キャピラリーでは先端部が最も鋭利なの で,最強の電場 E が先端に生じる.このキャピラリー先端 から電解質溶液が流出すると,液体は先端部において高電 場にさらされる(金属キャピラリー内部は導体に囲まれた



Fig. 1. エレクトロスプレーでの電気回路 (文献 2 より許可を得て改変, ©1993, American Chemical Society).

Table 1. 電気化学反応と標準電位 E<sup>0</sup>

| 反応  | $E^0$ (V vs. $2H^+/H_2$ ) |
|---|---------------------------|
| 酸化反応(正イオンモード)                                   |                           |
| 溶媒系反応   |                           |
| $4OH^{-}=2H_{2}O+O_{2}+4e^{-}$                  | 0.42                      |
| $2OH^{-}=H_{2}O_{2}+2e^{-}$                     | 0.29                      |
| $2H_2O = O_2 + 4H^+ + 4e^-$                     | 1.25                      |
| $2NH_4^+ = N_2H_5^+ + 3H^+ + 2e^-$              | 1.30                      |
| $NH_4^+ + H_2O = NH_3OH^+ + 2H^+ + 2e^-$        | 1.37                      |
| $2H_2O = H_2O_2 + 2H^+ + 2e^-$                  | 1.79                      |
| $OH^-=OH+e^-$                                   | 2.02                      |
| $2C1^{-}=C1_{2}(g)+2e^{-}$                      | 1.36                      |
| 電極反応  |                           |
| $Fe+2OH^-=Fe(OH)_2+2e^-$                        | -0.85                     |
| ${ m Fe} = { m Fe}^{2+} + 2e^{-}$               | -0.42                     |
| $Fe = Fe^{3+} + 3e^{-}$                         | -0.01                     |
| $Pt+2OH^{-}=Pt(OH)_{2}+2e^{-}$                  | 0.18                      |
| $Pt + 2H_2O = Pt(OH)_2 + 2H^+ + 2e^-$           | 1.00                      |
| 還元反応(自イオンモード)                                   |                           |
| 溶媒反応  |                           |
| $CH_{3}OH + 2H^{+} + 2e^{-} = CH_{4} + H_{2}O$  | 0.60                      |
| $2H_2O + O_2 + 4e^- = 4OH^-$                    | 0.42                      |
| $2H^{+}+2e^{-}=H_{2}$                           | 0.02                      |
| $CH_3COOH + 2H^+ + 2e^- = CH_3CHO + H_2O$       | 0.11                      |
| $CH_{3}OH + H_{2}O + 2e^{-} = CH_{4} + 2OH^{-}$ | -0.23                     |
| $2NH_4^+ + 2e^- = 2NH_3 + H_2$                  | -0.53                     |
| $2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$                    | -0.80                     |
| $Na^+ + e^- = Na$                               | -2.71                     |
| 電極反応  |                           |
| $Pt(OH)_2 + 2e^- = Pt + 2OH^-$                  | 0.18                      |
| $Fe(OH)_3 + e^- = Fe(OH)_2 + OH^-$              | -0.54                     |
| $Fe(OH)_2 + 2e^- = Fe + 2OH^-$                  | -0.85                     |

空間なので、電場は存在しないとみなせる). 対極に対して キャピラリーに正の高電圧を印加した場合、流出した液体 中の正イオンは外側へ, 負イオンは内側へと電気泳動し, 液体中での正イオンと負イオンの分離が起こる.しかし, この電荷分離だけでは、エレクトロスプレーは発生しな い、帯電した液滴が対極にスプレーされるという現象は、 過剰電荷が液体に供給されることによって初めて起こり得 る現象である. この過剰電荷を与えるのが、キャピラリー 先端部で起こる電気化学反応である (Fig. 1). この反応で 液体が過剰電荷で充電される. 正イオンモードでは, 酸化 反応, 負イオンモードでは還元反応が起こって, 液体が正, あるいは負に帯電し,ついには帯電液滴として対極に向 かって噴霧される. エレクトロスプレーで発生する全電流 量(エレクトロスプレー電流)は、電気化学反応によって 起こる酸化 (正イオンモード),あるいは還元反応 (負イオ ンモード)によって単位時間当たりに発生する電気量に等 U (Fig. 1 O TDC: total direct current)<sup>2</sup>.

キャピラリー先端で起こる可能性のある電気化学反応の 例を標準電位  $E^0$  とともに Table 1 に示す. この表から, 正イオンモードでは,水酸化物イオンが酸化されやすいこ と (4OH<sup>-</sup>=2H<sub>2</sub>O+O<sub>2</sub>+4 $e^-$ ),また水溶媒が酸化されてプ ロトンが供給されること (2H<sub>2</sub>O=4H<sup>+</sup>+O<sub>2</sub>+4 $e^-$ ),また, 負イオンモードでは酸性条件下でメタノールが還元されや すいこと (CH<sub>3</sub>OH+2H<sup>+</sup>+2 $e^-$ =CH<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O),また,酸素

ガス溶存水系で水酸化物イオン OH- が生成しやすいこと  $(2H_2O+O_2+4e^-=4OH^-)$ ,などが読み取れる.ここで,  $e^-$ とは、キャピラリー先端の金属表面でやり取りされる電子 を表す. 正イオンモードでステンレス鋼キャピラリーを用 いると、成分の鉄が酸化されて鉄イオンとして溶け出しや すい. 耐蝕性の強い金, 白金, チタンなどの材質を使用す れば金属イオンなどによるコンタミを防ぐことができるの で、試料に由来するイオンが観測されやすい. つまり、使 用するキャピラリーの材質によってエレクトロスプレーの マススペクトルの質が左右されるので、条件の厳しい実験 では操作上での工夫が必要となる場合がある. キャピラ リー先端でどのような電気化学反応が進行するかは、実験 系によって異なるので予測が難しいが、起こりやすい反応 (Table 1) が優先的に起こって、それらに由来する過剰イ オンが生成することはいうまでもない. また, 起こりやす い反応から始まって起こりにくい反応へ移っていくような 経時変化も考えられる.

#### 3. Taylor コーンとは何か

Fig. 1 に示すように、エレクトロスプレーではキャピラ リー先端に円錐形の液体が形成され、その先端から帯電液 滴が噴霧される.この円錐形を形成した液体を Taylor コーンと呼ぶ.

エレクトロスプレーと似たイオン源として, 高真空中に おいて高電圧が印加された鋭利な金属電極先端から金属イ オンが発生する液体金属イオン源がある. イオンは鋭い電 極の先端部から発生するので、点光源としてのイオン銃と して有用で、二次イオン質量分析 (SIMS) 装置のイオン源 などとして使われている. たとえば, Ga, Bi など融点の低 い金属を融解させ、これらの液体金属で鋭い先端をもつ高 融点の金属電極をぬらすと、その先端から Ga+, Bi+ イオ ンなどが脱離する(電界脱離現象:後述).二次イオン質量 分析法 (SIMS) では、この金属イオンをビームとして取り 出し、数十 nm 以下の空間分解能で試料のイメージング像 を得ている.この金属イオン源の先端部の撮像を行ったと ころ,ある臨界電圧において先端部に99°の頭頂角をもっ た円錐形のコーン (Taylor コーン) が形成されることがわ かった. この臨界電圧を超えると、円錐形の先端が伸びて 金属イオンの発生が始まる.液体金属イオン源では、数 nmの先端部から金属イオンが真空中へ脱離する.

電気伝導体(金属など)に電位を与えると,導体表面に 過剰電荷が誘起される(式(4)).この過剰電荷は表面にの み存在し,導体内部は電気的に中性が保たれる.これは, 導体内に電位差が生じると直ちに電流が流れて,電位差が 解消されて電気的に中性に戻るからである(静電平衡:式 (3)参照).このため導体の内部と表面はすべて**同電位**とな る.しかし,導体の表面が凸凹していると,出っ張った部 分の**電場**が凹んだ部分よりも大きくなる.金属導体表面の 電場 E は表面の曲率半径 r にほぼ**反比例**する(式(1)参 照.球体では厳密に r に反比例する:式(1) で K=1)<sup>1</sup>.

金属キャピラリーを用いるエレクトロスプレーにおい

て,最も強い電場がかかっているキャピラリー先端部から 液体試料が流出してくると、この電場の影響で金属と液体 の界面(接触面)で電気化学反応が起こり、キャピラリー 先端部の液体に過剰電荷が蓄積されていく、液体が存在し なかったときに金属キャピラリー先端表面に集まっていた 過剰電荷が電気化学反応の進行とともに液体に乗り移って いくと考えてよい.液体中の過剰電荷がしだいに増えてい くと、電荷同士のクーロン反発により、外側に向かう静電 力が生じて、流動性の液体が変形して、キャピラリー先端 に円錐形の液体が形成されてくる. これが, 電荷を外側に 逃がそうとする外向きの"静電圧" (electrostatic pressure) である. 電場はキャピラリーと対極の間に印加され ているので、帯電した液体は対極に向かって引かれて伸び ようとする.一方,流体は表面張力をもち,これが液体の 表面積をなるべく小さくしようとする内側に向かう力とし て働く. Rayleigh 極限と呼ばれる臨界状態でこの二つの 力が円錐形のすべての点でちょうど釣り合うと、頭頂角 99°の Taylor コーンが形成される (Fig. 1). 過剰電荷量が Rayleigh 極限の臨界値を超えると(これはキャピラリー に印加する電圧をエレクトロスプレー発生まで高めること に相当する), Taylor コーンの先端が伸びて, その液柱の 先端部から帯電液滴が気相に噴霧されて,対向電極に向 かって飛ぶ (Fig. 1). これは、溜まりすぎた過剰電荷を外に 吐き出して捨てる自然のメカニズムである. 過剰電荷の排 出や放電現象は,必ず尖った部分から始まるという現象は 普遍的である. 大気圧化学イオン化法において使われる直 流コロナ放電電極は尖った針電極を使用するし、雷は避雷 針めがけて落ち、冬の乾燥時に衣服を脱ぐときには、細い 繊維の先端から放電が発生する. 電界イオン顕微鏡は, 鋭 利な針先端に生じる高電場によりヘリウム原子などを"ト ンネルイオン化"(電界イオン化現象:後述)して,先端部 の原子配列を観測する技術であり、また走査型トンネル顕 微鏡は原子レベルで尖らせた金属プローブ先端と観測対象 物を接近させ、プローブ先端に生じている電場によって導 電性試料との間に発生するトンネル電流を測定し、表面の 原子配列を観測する方法である. このように, 尖らせた金 属先端部において極限的な現象を起こさせることができ る.

ェレクトロスプレーという現象を理論的に考察すると以下のようになる.液体の表面張力に起因する**圧力** $P_r$ (表面に対して垂直な内側に向かう)は液体の表面張力rと曲率  $\kappa$ の積に比例する.

$$P_{\gamma} = \gamma \kappa$$

(5)

また、電場 E をもつ導体表面には、同符号の電荷同士によるクーロン斥力に基づく**静電圧**  $P_E$  (表面に対して垂直な外側に向かう)が作用する.この外側に向かう静電圧は  $E^2$  に比例する<sup>3</sup>.

$$P_E = 0.5\varepsilon_0 E^2 \tag{6}$$

静電圧  $P_E$  は、Poisson の方程式から導出できる<sup>3)</sup>. 帯電液 体中の過剰電荷は静電圧  $P_E$  によって外に逃げようとし て、液体の形状を円錐形に変化させる. 尖った先端部に溜



Fig. 2. エレクトロスプレーのパルス的発生. 試料: 0.1% 酢酸の水-メタノール (1:1) 溶液. 試料流量: 1μL/min, キャピラリー 内径: 100μm, キャピラリーへの印加電圧: 3.7 kV, 対向電極までの距離: 10 mm.

まる過剰電荷で生じる静電圧  $P_E$  が液体の表面張力に基づ く  $P_r$  と円錐形のすべての点で釣り合った状態,  $P_r = P_E$ , で円錐形の Taylor コーンの形成に至る(頭頂角 99°). こ こで, Taylor コーンの先端に近づくほど,  $P_r$  と  $P_E$  の値が 大きくなることを指摘しておく. つまり, 先端部が最も大 きな過剰電荷密度をもつ<sup>3)</sup>. この理由で, Taylor コーン先 端から帯電液滴が発生するのである.  $P_r = P_E$  が成り立つ 敷居値のポテンシャル  $V_c$  は以下の式で与えられる.

$$V_{\rm c} = 0.863 (\gamma d/\varepsilon_0)^{0.5}$$
 (7)

すなわち,エレクトロスプレーが発生する敷居電位は,対 極への距離 d と表面張力 γ の平方根に比例する. キャピ ラリーに印加する電位を上げて  $P_E > P_r$  の条件にすると円 錐形液体の頭頂角が 99°よりも小さくなり、液体が対極に 伸びて、エレクトロスプレーが発生する.帯電液滴が Taylor コーンから離れて対極に飛び去ると、これにより 溜まった過剰電荷が排出されて静電圧が一挙に弱まる. こ の結果,エレクトロスプレー現象がいったん停止する.し ばらくすると再び金属界面での電気化学反応によって液体 へ過剰電荷が供給されて,再びエレクトロスプレーが発生 する. エレクトロスプレーはこのような過渡現象の繰り返 しで起こる. Fig. 2 に筆者らが観測したエレクトロスプ レーの時間変化を示す. (a) から (e) が1 周期である. この ように断続的にスプレーが発生するため、エレクトロスプ レーは電気的くしゃみ (electric sneeze) と表現される. こ の現象の周期は数百msであった(振動数:数kHz).

Vertes らも,水・メタノールのエレクトロスプレーにおいて,同様の現象を観測している<sup>4)</sup>. この事実は, Fig.2における1サイクルの噴霧現象には,約数百µs 程度の充電時間が必要であることを示す.

#### 帯電液滴の分裂

エレクトロスプレーで発生した帯電液滴は, Rayleigh 極限を超えて Taylor コーン先端から飛び出した帯電液滴 なので,それ自身が Rayleigh 極限に近い帯電状態にあ る.実際には流体には不安定な揺らぎがあるので,帯電液



Fig. 3. 帝電液周の分裂. N: 帝電液周中の週剰電何数, K: 液滴の半径 (μm), Δt: 生成した帯電液滴が分裂に要 する時間. (文献 2 より許可を得て改変. ©1993, American Chemical Society).

滴は Rayleigh 極限値に相当する過剰電荷数  $N \circ 70 \sim 80\% \circ$ の過剰電荷をもって Taylor コーンから飛び出す. エレクトロスプレーで発生した帯電液滴から溶媒が気化すると、過剰電荷密度がしだいに増加し、ついには Rayleigh 極限に達して分裂する. Fig. 3 に帯電液滴が分裂する様子を示す<sup>2</sup>. N は過剰電荷数, R は液滴の半径 ( $\mu$ m)を表す. 帯電した流体が Rayleigh 極限に達すると、流体は 2 等分割されるのではなく、ラッキョウのように非対称的に変形して鋭い突起部が形成され、ここから過剰電荷が微細な二次帯電液滴としてスプレーされる (Fig. 3 左下挿絵). この現象は、Fig. 1  $\circ$  Taylor コーンからの帯電液滴発生現象と本質的に同じである.

帯電液滴が分裂する場合,一次液滴の約10分の1の半 径をもつ二次液滴(体積換算すると約1,000分の1)が20 個程度連続的に一次液滴から出射される.この際,一次液 滴から約15%の電荷が運び去られるが,質量減少は2% 程度である<sup>5)</sup>. このように、帯電液滴の分裂によって、一次 液滴の過剰電荷がサイズの小さな二次液滴に濃縮されるこ とになる.帯電液滴が分裂した後の一次液滴と二次液滴 は、両者ともに Rayleigh 極限に近い電荷を保っている. 帯電液滴の分裂で、サイズの小さな液滴に電荷が濃縮され るのは、いびつな形をもつ導体において曲率半径が小さい 部分ほど、より高い表面過剰電荷密度  $\sigma$  (C/m<sup>2</sup>) をもつと いう物理現象に関連する (式 (4) 参照)<sup>1)</sup>. たとえば、細い導 線でつながれた同電位にある二つの球体の半径を、おのお の  $r_1, r_2$ , 過剰電荷密度を  $\sigma_1, \sigma_2$ , 表面の電場を  $E_1, E_2$  とす ると、式 (4) より、

$$r_1/r_2 = \sigma_2/\sigma_1 = E_2/E_1$$
 (8)

となる.このように、帯電液滴の分裂によって生成したより小さな液滴に、一次液滴に比べてより大きな表面電荷密度  $\sigma$ が与えられるのは、物理法則の必然性に基づく<sup>1)</sup>.

ここで, Rayleigh 極限にある半径 *R* の液滴とそれに含 まれる過剰電荷数 *N* の関係を以下に示す.

$$N = (\gamma \varepsilon_0 R^3)^{0.5} \times 8\pi \tag{9}$$

式 (9) 中の  $R^3$  は液滴の体積, すなわち質量に比例する. こ の式から, 過剰電荷数 N は, 帯電液滴の質量の平方根に比 例して増加することがわかる. 言い換えれば, N が増加す ると, それを保持するためには液滴の質量を N の 2 乗に 比例して増加させる必要があるということである. これ は, 帯電液滴中の過剰電荷の大部分が液滴表面近傍に存在 し, 液滴内部はほぼ中性に保たれるという事実と関連す る. 電気伝導性物体の帯電には必ずこのような現象が伴う (絶縁体の場合であれば, 過剰電荷は内部に分布可能であ る).

過剰電荷 N は, 帯電液滴の表面に局在するので, Rayleigh 極限にある帯電液滴の表面電荷密度 N<sub>s</sub> は式 (10) で 与えられる.

$$N_{\rm s} = N/4\pi R^2 = 2(\varepsilon_0 \gamma)^{1/2}/R^{1/2} \tag{10}$$

この式から, Rayleigh 極限にある帯電液滴形成に際して, 半径の小さな液滴ほど大きな表面電荷密度  $N_s$  をもつこと がわかる. エレクトロスプレーでは,キャピラリーの径 Rを小さくすることで,帯電液滴サイズを小さくできるの で, $N_s$ を増強できることになる. これは,キャピラリー径 を小さくすることで,キャピラリー先端の電場が増強され ることと同義である(式(1)および式(6)参照).

#### 5. 帯電液滴からどのようにして気相イオンが発生するか

エレクトロスプレーで発生する帯電液滴は、二次液滴 も、またそれを発生させた元の一次液滴も、ともに Rayleigh 極限に近い帯電状態にある.これら液滴から溶媒が 気化すると、両者が再び分裂を起こす (Fig. 3).クーロン 斥力による分裂なのでクーロン爆発と表現される場合もあ る.帯電液滴から最終的に気相イオンが生成する機構に は、①帯電残滓機構 (charged residue 機構: CRM)、およ び、②イオン蒸発機構 (ion evaporation 機構: IEM)、の 二つが提案されている.帯電残滓機構では、Fig. 3 に示す ような帯電液滴の複数回の分裂によって、最終的に試料イ

オンが1個含まれる微小液滴が生成し、これが乾燥して最 終的に気相イオンを生成するというものである. 一方, イ オン蒸発機構は、帯電液滴の分裂と乾燥で液滴の直径が数 + nm になったところで,過剰電荷同士のクーロン反発の ためにイオンが液滴から脱離するという機構である.種々 の実験で、この二つの機構がともに気相イオン生成に関与 していることが明らかとなっている. たとえば, 界面活性 なイオンは、親水性のイオンに比べて帯電液滴の表面に選 択的に凝集しやすく,イオン蒸発機構で生成しやすい.イ オン蒸発機構によって帯電液滴からイオンが蒸発し始める 際の,液滴表面の電場は 10<sup>8</sup> V/m 程度と見積もられてい る.一方,親水性のイオンは液滴表面には存在しにくく, 液面下の液体内部に存在する。したがって、液滴の分裂過 程において、まず疎水性のイオンが二次液滴に選択的に取 り込まれ、残された一次液滴内にはより親水性の高いイオ ンが取り残される。また分子量が大きなイオンの場合(ペ プチドやタンパク質分子など),複数回の液滴分裂過程を 経て生成した残滓液滴に1個のイオンが取り残されて、こ れが最終的に気相イオンとして検出されると考えられる. これが帯電残滓機構である.このような場合では、液滴中 に過剰電荷(界面活性をもたないプロトンやアルカリイオ ンなど)が多く残存しているので、ペプチドやタンパク質 分子など気化しにくい大きな分子は多価イオンとして観測 されやすい.

以上を概略すれば、帯電液滴の分裂に際して、帯電した 一次液滴からまず優先的に疎水性でサイズの小さなイオン が選択的に二次液滴に乗り移り、これらがイオン蒸発機構 で気相イオンを生成する.より親水性が大きな、またサイ ズが大きなイオンは一次液滴に残りやすく (Fig. 3)、これ が帯電残滓機構で最終的に気相イオンを生成する.

Fig. 1 に示したように, 従来のエレクトロスプレー (キャピラリー内径: ~100 µm) で発生する初期の帯電液 滴サイズは半径が約数μm である. この液滴に存在できる 過剰電荷は, Rayleigh 極限から, 最高で 5×10<sup>4</sup> 個程度と なる. もし, エレクトロスプレーで検出しようとしている 試料の濃度が 10<sup>-5</sup> M とすると、半径 1.5 µm の液滴内に 存在する試料分子数は約105 個である.この個数は過剰電 荷数にほぼ近いので、効率よく過剰電荷によって試料がイ オン化されやすい. したがって, エレクトロスプレーで 10<sup>-5</sup> M 程度の濃度の試料を検出するのは難しくない. し かし、たとえば生理食塩水濃度をもつ生体の体液などでは NaClが 150 mM (0.9%) 程度含まれる. この場合, 半径 1.5 μmの液滴には約10<sup>9</sup> 個のNa<sup>+</sup> とCl<sup>-</sup> イオンが含まれ る. この食塩水中に 10<sup>-5</sup> M の分析目的試料が含まれてい る場合,この試料分子の数は Na+ や Cl- の約一万分の一 となる. 一万倍も多く含まれる Na<sup>+</sup> や Cl<sup>-</sup> イオンの中か ら分析目的イオンを選択的に気相に取り出すことはそれほ ど容易なことではなく、分析イオン種の表面活性が高くな い限り気相イオンとして観測することは難しい. これが, 共存する塩によるサプレッション効果である.また,塩濃 度が高くなるにつれて、エレクトロスプレーが発生しにく

くなるので、さらに分析目的成分の検出が困難となる(8 節参照). このような塩によるサプレッション効果は、エレ クトロスプレーのダウンサイジング(ナノ化)で大幅に緩 和される(9節参照).

## 6. エレクトロスプレーしやすさは液体試料の 表面張力に依存する

液体は表面張力をもつので、その表面積をなるべく小さ くしようとする. ところが, エレクトロスプレーは液体を 細かな液滴として噴霧させる現象なので、液体の表面積は 大きく増大する. つまりエレクトロスプレーは液体の表面 張力に逆らう現象である.したがって、液体の表面張力を 小さくしてやれば、エレクトロスプレーは発生しやすくな る. 水の表面張力 $\gamma$ は大きいので(常温で $\gamma = 72 \times 10^{-3}$ N/m), 水溶液試料をエレクトロスプレーすることが難し いことは、エレクトロスプレー実験に携わる人がよく経験 するところである.ところが,この試料にメタノール (γ=  $22 \times 10^{-3}$ N/m) やアセトニトリル ( $\gamma = 28 \times 10^{-3}$  N/m) を 加えると、エレクトロスプレーが発生しやすくなる.これ は、有機溶媒の添加で混合液体の表面張力が小さくなるか らである. これは、メタノールやアセトニトリルが水に比 べてより疎水性なため,水溶液の表面に凝集しやすく,水 のみの場合に比べて表面張力が減少するからである. [有 機溶媒/水] 混合溶媒の水に対する有機溶媒の表面組成は, バルク組成よりも必ず大きくなる.お酒を楽しむとき、グ ラスの中のお酒の表面をすすりながら飲むと酔いが早くな るかもしれない.

式(5)から,表面張力( $\gamma$ )による圧力 $P_r$ は, $\gamma$ に比例す るので, $\gamma$ が小さいほど低い電圧でエレクトロスプレーを 発生させることができる.ある溶媒に溶質を溶かした場 合,液体表面の溶質濃度が液体内部の溶質濃度よりも高く なる場合と低くなる場合がある.前者を正吸着,後者を負 吸着という.界面活性なイオンがあると,これらが液体表 面に吸着して表面張力を下げるので,エレクトロスプレー が発生しやすくなる.逆に,塩のような界面活性をもたな い溶質をエレクトロスプレーで検出することは比較的難し い.これは,負吸着,すなわち溶質が液体内部に存在しや すいことから,一次液滴から生成する二次帯電液滴内に取 り込まれにくくなるからである.正吸着しやすい試料はイ オン蒸発機構で,また負吸着しやすいイオンは帯電残滓機 構で検出されやすい.

## 有イオンモードは正イオンモードに比べて エレクトロスプレーしにくいのはなぜ?

エレクトロスプレーの論文を検索すると,正イオンに比 べて,負イオン関連の論文が比較的少ない.この理由の一 つは,正イオンモードに比べて負イオンモードでのエレク トロスプレーが安定に発生させにくいからである.エレク トロスプレーを安定に持続させるうえでの大敵は,キャピ ラリー先端に発生するコロナ放電プラズマである.高電場 が印加されている気体に宇宙線など何らかの作用で電子が

#### 電子の電界放射



Fig. 4. トンネル効果による電子の電界放出. (a) 電場がない場合の電子のポテンシャル. (b) 金属に負の高電位を与えた場合の電子のポテンシャル. Ø: 仕事関数.

供給されると、電子が電場によって加速されて、気体をイ オン化する.この気体のイオン化で、さらに電子が生成し、 この電子が気体をイオン化する、という現象が次々と雪崩 のように増幅されて、プラズマ発生に至る.このように、 プラズマの発生は電子がきっかけとなる.正イオンモード のエレクトロスプレーでは、金属キャピラリーが正の高電 位にあるので、プラズマ発生の種になる電子が発生したと しても、この電子は金属キャピラリーに吸い取られ、プラ ズマ発生がある程度抑制される.ところが、負イオンモー ドでは、キャピラリーが負の高電位にあり、電子はキャピ ラリー先端から外側に向かって放射状に加速され、周辺の 気体分子をイオン化して、プラズマを発生させやすい.ま た、鋭利な金属キャピラリー先端部で起こるトンネル効果 で電子が発生しやすく、この電子がプラズマ発生の誘因と なる.

Fig. 4 に, 鋭利な金属先端に印加された負の高電場に よって, 金属内の電子がトンネル効果によって外に飛び出 す概念図を示す. 金属内の電子は図に示すように, Fermi 準位まで占有されている. 電子を気相に飛び出させるため には, 最低でも仕事関数(Φ)に相当するエネルギーを電子 に与えなければならない. ここで, 金属に高い負の電位 (ポテンシャル)を印加すると, 金属面外側の電位が対極に 向かって下がる. 電子は, 質量が小さいので, 大きなド・ ブロイ波長 λ をもつ.

$$A = h/mv = h/p \tag{11}$$

(h: Planck 定数, m:電子の質量, v:電子の速度, p:電子の 運動量).ド・ブロイ波長 $\lambda$ が障壁の厚さ,  $\Delta x$ , に近くなる と,電子は仕事関数の障壁 $\phi$ を超えずに,トンネル効果で 外側にしみ出すことができる.これが電子の**電界放射**現象 である.負イオンモードでのエレクトロスプレーでは, キャピラリー先端からこのようなトンネル効果による電子 の供給が行われやすいので放電が発生しやすくなる.用い るキャピラリー先端にギザギザな尖った部分(バリ)があ ると,そこから放電しやすくなるので注意が必要である. ちなみに,鋭利な金属針電極先端からの電子のトンネル放 出は,点光源に近い電子発生源として,電子顕微鏡の電子 銃に応用されている(電界放出型冷陰極).

プラズマとは、ほぼ同密度の正イオンと電子(あるいは 負イオン)とからなる空間と定義され、電気伝導性を示す ので、キャピラリー先端にプラズマが発生するとキャピラ リー先端に印加されていた局所高電場が一挙に弱められ る. このため、キャピラリーから流出する液体は金属界面 での電気化学反応を起こさなくなり、観測されるイオンは 気体放電で生成したイオン種が主となる. 放電発生は、 キャピラリー付近に SF<sub>6</sub> ガスを供給したり、試料溶液中に CCl<sub>4</sub> などを添加することである程度抑制することができ る. これは、これらの化合物が正の電子親和力をもち、放 電発生の種になる電子を捕捉するからである(気相におけ る電子捕獲反応).

$$SF_6 + e \rightarrow SF_6^-$$
 (12-1)

$$\rightarrow SF_5^- + F \tag{12-2}$$

$$\operatorname{CCl}_4 + e \to \operatorname{Cl}^- + \operatorname{CCl}_3 \tag{13}$$

## 8. 塩を含む溶液がエレクトロスプレー されにくいのはなぜか

エレクトロスプレーで起こる電気化学反応による全イオ ン電流 *TDC* (Fig. 1) は,溶液の電気伝導度 *K* に依存し, *K* の増加に伴って電流が増加することが知られている.

 $TDC \propto K^n$ (14)nの値は,実験条件によって異なり,0.2から0.4の値をと ることが多い. K の増加でエレクトロスプレー電流が増加 するのは、キャピラリー先端で起こる電気化学反応が促進 されるからである. この現象は化学電池における電気化学 反応でよく知られた現象である.電池などの電気化学反応 においては、なるべく大きな電流を取り出すために、電気 化学反応には直接関与しない支持電解質(塩素酸カリウム など)が加えられる.支持電解質は、電極表面で起こる酸 化・還元反応には関与しないにもかかわらず、その添加で 反応が促進される点が興味深い. エレクトロスプレー現象 にも深く関係するので,なぜこのような現象が起こるのか を考えておく. 電解質溶液中の陽極と陰極の間に電位差を 与えた場合、陽極と陰極の近傍で大きな電位差が生じ(陽 極と陰極近傍において陰イオンと陽イオンの濃度に相違が 生じてこれが電位差を生む: Poisson の方程式から理解さ れる),中間領域では電位の変化はなだらかとなる.この傾 向は、溶液の電気伝導度 K (すなわち電解質濃度 C<sub>0</sub>)の増 加で顕著になる. 電極表面近傍に生じる大きな電位差のか かった領域の厚さは、電解質溶液中のイオンの Debye 遮 蔽長  $\lambda_D$  の数倍程度とみなせる.

 $\lambda_D(nm) = 0.305/C_0^{1/2}$  (15)  $C_0$ は溶液中のイオンのモル濃度である.電解質溶液中の 陽イオンと陰イオン(気相イオンは、正・負イオンといわ れる)はお互いにクーロン引力で相互作用する.すなわち、 陽イオンの近傍には陰イオンが集まり、陰イオンの周りに は陽イオンが集まって、お互いの電荷を中和している.こ れによって、イオンの生じる電場(クーロン場)が反対電 荷イオンで遮蔽される.実質的に  $\lambda_D$  以上の領域は電気的 に中性とみなすことができる.電解質濃度 ( $C_0$ )が高くな ると  $\lambda_D$  が小さくなる(式(15)).すなわち、陽極と陰極の 表面近傍に生じる大きな電位差がかかる領域が薄くなって いく.つまり、この領域の電場が大きくなる.このため、 この領域に存在する反応に関与するイオンの電場中の移動 速度が大きくなって、電気化学反応の速度が増す結果につ ながる.

これと同様に、エレクトロスプレーでのキャピラリー先 端で起こる電気化学反応も、電気伝導度 K, すなわち電解 質濃度 C<sub>0</sub>の増加で促進される(式(15)). つまり,過剰電 荷の生成速度が速まり、より短い時間内に Taylor コーン 形成の条件が整い、エレクトロスプレー電流量も増大す る. ところが, 電解質濃度が 10<sup>-2</sup> M を超える辺りから, エレクトロスプレーが不安定になってくる. キャピラリー 先端に印加されている電場で十分な過剰電荷がキャピラ リー先端の液体に供給されるにもかかわらず、エレクトロ スプレーが発生しにくくなるのである. この現象はどう解 釈すればよいのだろうか. キャピラリー先端の液体に付与 された過剰電荷は、液体表面近傍に集まる. ここで電解質 濃度が高まると、この過剰電荷は溶液中に共存する高濃度 の反対符号電荷によって遮蔽されて実質的な電場が減殺さ れる. このため,過剰電荷同士のクーロン反発力(外に向 かう静電圧)が弱まり、エレクトロスプレーが発生しにく くなると考えられる. ちなみに, 150 mM の生理食塩水濃 度における Debye 遮蔽長 λ<sub>D</sub> は,式 (15) からわずか 1 nm 程度と計算される.この濃度の電解質溶液になると、イオ ン同士の相互作用が分子の大きさの数倍程度の近距離相互 作用になることがわかる. 生体内では、このような密にイ オンが存在する環境の中で営みが行われている.

高塩濃度の溶液をエレクトロスプレーさせようとして強 引にキャピラリーの電圧を上げると、エレクトロスプレー が発生する代わりにキャピラリー先端で気体の放電破壊が 起こる.150 mM 程度の塩濃度をもつ生体の体液などを直 接エレクトロスプレーするのが難しいのはこのような理由 による.しかし、後述するように、探針エレクトロスプ レーでは、体液など生理食塩濃度の水溶液が容易にエレク トロスプレーされる(9節).

Fig. 1 に示すように、エレクトロスプレーでは、キャピ ラリーが大気を介して対向電極と向き合っている. これ は、一種のコンデンサーとみなせる. 両者に電位差が与え られると、キャピラリーと対極の金属表面に過剰電荷  $\pm Q$ が誘起される (コンデンサーの充電).

#### $Q = C \times V$

(16)

Q はコンデンサーにたまる電荷量, C はコンデンサーの容 量, V はコンデンサーに加えられた電圧である. キャピラ リー先端に電解質溶液が流出するとキャピラリー先端で電 気化学反応が起こり, 金属キャピラリー電極表面に溜まっ ていた電荷が液体に乗り移っていく. 帯電した液体がつい には Rayleigh 極限に達して, 帯電液滴として対極に向 かって飛ぶ. これは, 大気という誘電体を介したコンデン サーから電気がリーク(漏電)しているようなものである (過剰電荷の排出現象).

## 9. エレクトロスプレーのナノ化で検出効率が 上がるのはなぜか: ESI, nanoESI, および探針エレクトロスプレー

エレクトロスプレーのイオンシグナル強度は,液体試料 の流量にはあまり依存せず,主に濃度に依存するという傾 向がある<sup>5</sup>. たとえば,送液量を増やしても,シグナル強度 は期待したほどは増加せず,逆に流量を下げるとシグナル 強度が増えることさえある. この現象は,エレクトロスプ レーの本質に深くかかわっている.エレクトロスプレーと いう現象の本質は,キャピラリー先端で起こる電気化学反 応に起因することを繰り返し述べた.電気化学反応は金属 表面で起こる界面反応で,溶液中のイオンの拡散移動が関 連する比較的ゆっくりした反応である. この点について は, van Berkel らの論文が参照に値する<sup>6</sup>.

エレクトロスプレーでは、液体試料が連続的にキャピラ リー先端に供給されるので、単位時間当たりの送液量が大 きくなるほど単位体積当たりの液体に与えられる過剰電荷 の割合が減少する. Fig. 5 に、従来のエレクトロスプレー (キャピラリー内径: ~100  $\mu$ m)、ナノエレクトロスプレー (内径数  $\mu$ m)、および探針(先端直径~700 nm)を用いた 場合において、液体試料と金属先端部における濡れの相違 の概念図を示す. 探針を用いるものは、筆者らが開発した 探針エレクトロスプレー (probe electrospray: PESI)であ る<sup>7)~9</sup>.

電気化学反応は,高電場が発生しているキャピラリーの 出口付近でのみ起こるため,従来エレクトロスプレー (キャピラリー内径:~100µm)のように数µL/minの流 量を取り扱う操作では,液体への過剰電荷供給の効率は低 くならざるをえない.このため,エレクトロスプレーが安 定に持続しにくく,一般的に気送ネブライザーなどの支援 で液体をスプレーする方式が採用されている.液体試料を エレクトロスプレーするためのキャピラリーと同軸の外筒 キャピラリーを用いて,エレクトロスプレー用キャピラ リー先端部に高圧ガスを流すと,内筒のキャピラリー先端 での放電破壊が起こりにくくなる(Paschenの法則).こ のため,ネブライザーガスを使用することで,より高い電 圧をキャピラリーに印加することができる.この結果, キャピラリー先端部での電気化学反応がより促進されて,



Fig. 5. エレクトロスプレーのダウンサイジング.



Fig. 6. 探針エレクトロスプレーの駆動部.

エレクトロスプレー電流が増加する. これは,より大きな 過剰電荷をもつ帯電液滴形成につながる. また,ネブライ ザーガスの使用で,スプレーされる液滴サイズが微細化さ れるので,帯電液滴の乾燥が容易となり,帯電液滴中のイ オンの気相への脱離効率も高まる. これらの効果によって 試料の検出感度が向上する.

キャピラリーから流出する液体試料の流量を減らしてい くと、単位体積当たりの液体試料への過剰電荷供給量が増 す.これが、従来エレクトロスプレーに比べてナノエレク トロスプレーによる試料検出効率が桁違いに高くなること を説明する.さらに、探針を用いた場合では、液体試料は 探針表面を薄くぬらすだけなので、[金属界面と接触する 液体]/[液体の体積]の比が最も大きくなり、極めて効率 のよいエレクトロスプレー発生条件が整う.

Fig. 6 に, 探針エレクトロスプレーの駆動部の写真を示 す. この方法では, キャピラリーの代わりに探針を用いる. 探針を直動式モーターで上下運動させて, 下至点において 探針先端部と試料を接触させることで試料を捕捉し, 上至 点において直流の高電圧を印加して, 先端に捕捉した試料 をエレクトロスプレーさせる.

Fig. 7 に, 探針先端に捕捉された数 pL の試料 (10<sup>-5</sup> M グラミシジン S および 10<sup>-2</sup> M 酢酸アンモニウムの水溶 液) がエレクトロスプレーされる様子 (スナップ写真) を 示す<sup>9)</sup>. 探針への印加電圧は +2.5 kV である. 電圧印加後 約 1 ms 経過した時点ですでに, 探針先端に fL 程度の小 さな液粒 (Taylor コーン) が現れ, その先端からスプレー の発生が始まる. 10 ms から 15 ms でスプレーの電流値 が最大になる. スプレー発生までに 1 ms 程度 (以内) の 誘導期があるのは, 探針先端部での電気化学反応で Rayleigh 極限に近い過剰電荷が供給されるのに ms 程度 (以 下) の時間がかかることを意味する. つまり, エレクトロ スプレー現象は電気化学反応律速となる.

探針エレクトロスプレーでは、金属探針の先端表面を薄 くぬらした液体試料に効率よく過剰電荷が供給されるの で、従来エレクトロスプレーやナノエレクトロスプレーで



Fig. 7. 2.5 kV の電圧が印加された後の探針先端からのエレクトロスプレー発生. 探針先端直径: 700 nm, 探針先端に捕捉された 試料量:数 pL, 試料: 10<sup>-5</sup> M グラミシジン S および 10<sup>-2</sup> M 酢酸アンモニウムの水溶液. (文献 9 より許可を得て転載. ©2008, American Chemical Society).

は起こりにくい現象が観察される.たとえば、ほぼあらゆ る水分を含む試料に対して, 試料無調製でマススペクトル が得られる(果物,動物の体液,生体組織,清涼飲料水, 酒類,など液状試料全般)<sup>7),8)</sup>.たとえば,バナナの身や皮 を直接探針でつつくだけで、糖の K+ 付加体などが観測さ れる.また、尿や脳脊髄液のような高塩濃度の生体試料の 直接測定で、試料特有のマススペクトルが得られる.粘り 気のあるイクラでもマススペクトルを得ることができる. 得られるマススペクトルには、塩のクラスターイオン、 Na<sup>+</sup>(NaCl)<sub>n</sub>, がほとんど現れないという点が特異的であ る. これは、生体試料中の塩の組成である塩化物イオンの 酸化, 2Cl-→Cl<sub>2</sub>, が起こり, 試料中の負イオン濃度が減少 すること、また生成する液滴サイズがイオン対を含まない 程度にまで微細化されていること、などに起因する可能性 があるが,はっきりしたことはわからない. 先端に捕捉さ れる試料採取量は,探針の先端形状によるが,Fig.6の探 針 (先端直径~700 nm, 探針直径 100 µm の鍼灸針 (セイ リン))を用いた場合では、pL 以下である. 一例として Fig.8に、ヒトの母乳と乳児用に調製されたミルクを直接 測定したマススペクトルを示す8). 脂質成分の構成にはっ きりした相違がみられる.

母乳 100 (%) Intensity ( 80 60 Relative 40 20 1000 1500 500 m/z 牛乳 100 ntensity (%) 80 60 Relative 500 1000 1500 2000 m/z

Fig. 8. ヒトの母乳と乳児用に調製されたミルクを直接測定した探針エレクトロスプレーマススペクトル.
 (文献 8 より許可を得て改変. ©2008, Wiley Inter Science).

探針先端径は µm 以下なので, 生体試料のナノイメージ

K. Hiraoka



Fig. 9. マウス脳の深さ方向マススペクトル.

ング像の測定も可能となった. Fig. 9 に探針エレクトロス プレーによって、マウス脳の特定部位の深さ方向イメージ ングを測定した例を示す<sup>10</sup>(最大侵入深さ:  $30 \mu m$ , 試料 に開けられる穴の直径:約 $20 \mu m$ ). 試料は無調製でその まま試料台に載せて測定された.

左図に示すように,表皮細胞からはプロトン化されたリン脂質が検出されるが,侵入深さが増すにつれて,K<sup>+</sup>付加体のイオン強度が強くなる.

Fig. 10 に、試料台にマウス脳の切片を載せて、内部への侵入深さを 100  $\mu$ m 一定として、探針を 1,500×1,800  $\mu$ m の範囲内において 60  $\mu$ m 間隔で移動・操作し、イ メージング測定を行った結果を示す<sup>11)</sup>. 1 ピクセルサイズ は 60  $\mu$ m で、測定点は 25×30=750 箇所である.

m/z 782.6 と m/z 756.6 は, おのおの [PC 34:1+Na]<sup>+</sup> と [PC 32:0+Na]<sup>+</sup> であり, 測定した領域にほぼ普遍的 に存在している (PC: phosphatidylcholine). m/z 810.6 [PC 36:1+Na]<sup>+</sup> と m/z 826.6 [PC 36:1+K]<sup>+</sup> は主に白 質に分布している. 一方, m/z 828.6 [PC 38:6+Na]<sup>+</sup> は, 白質よりも灰白質に多く分布している. これらの結果は, DHB をマトリックスとして用いた MALDI (matrixassisted laser desorption/ionization) の結果とよく一致 する<sup>12</sup>.

分布のコントラストが最もはっきりしているのが,白質 に集中している m/z 822.7,850.7,および 934.7 のピーク である. m/z 850.7 のピークはナノ粒子を用いた MALDI によって,galactosylceramide の Na<sup>+</sup> 付加体,[GalCer 24h:0+Na]<sup>+</sup>,と同定されている<sup>13)</sup>. m/z 822.7 および 934.7 のピークは,[GalCer 422h:0+Na]<sup>+</sup>および



Fig. 10. 探針エレクトロスプレーによるマウス脳のイメージング測定. (a) m/z 782.6 ([PC 34: 1+Na]<sup>+</sup>), (b) m/z 810.6 ([PC 36: 1+Na]<sup>+</sup>), (c) m/z 826.6 ([PC 36: 1+K]<sup>+</sup>), (d) m/z 756.6 ([PC 32: 0+Na]<sup>+</sup>), (e) m/z 828.6 ([PC 38: 6+Na]<sup>+</sup>), (f) m/z 822.7 (GalCer 22h: 0+Na]<sup>+</sup>), (g) m/z 850.7 (GalCer 24 h: 0+Na]<sup>+</sup>), (h) m/z 934.7 (GalCer 30h: 0+Na]<sup>+</sup>), (i) m/z 1094.9. ピクセルサイズは 60 µm. 測定範囲: 1,500×1,800 µm<sup>2</sup>.

(文献11より許可を得て転載. ©2009, Wiley InterScience).

[GalCer 30h:0+Na]<sup>+</sup> と考えられる.

MALDI によるマウス脳のイメージング測定では, PC と galactosylceramides の検出に際してはおのおの異な るマトリックスを用いる必要がある<sup>12), 13)</sup>. これに対して探

針を用いるイメージング測定では,試料無調製でこれらの 脂質を同時に観測することができる.

探針エレクトロスプレーは、断続的な繰り返し操作で試 料採取する方法なので、生体反応などの経時変化も追跡で きるので、応用範囲が広い.

式(2)から,先端径 700 nm の探針先端の電場強度を計 算すると,10<sup>8</sup> V/m 程度となる.従来エレクトロスプレー (キャピラリー外径:~200 µm)におけるキャピラリー先 端の電場10<sup>6</sup> V/m に比べて2桁程度高いという計算にな る.このような高電場では,通常気体の放電破壊が起こる が,探針エレクトロスプレーでは,放電は発生しにくくエ レクトロスプレーが安定に持続しやすい.これは,電場が 最も強くなる探針先端が液体によってぬれるからである. 気体に比べて液体は非常に放電しにくいので,ぬれた探針 先端から放電が発生することなく液体試料がエレクトロス プレーされることになる.

エレクトロスプレーで発生する帯電液滴のサイズを極限 的に小さくすることができれば,試料イオンを1個だけ含 む帯電液滴を形成できるので,究極の検出感度が得られる であろう. Wilm と Mann は, Taylor コーン表面が等電 位にあるという仮定をもとに(電解質溶液に対してよい近 似), Poisson 方程式を解いて,エレクトロスプレーで発生 する液滴サイズを与える式(17)を導いた<sup>3)</sup>.

 $r_e = ({\rm d}V/{\rm d}t)^{2/3}$ 

× $\rho^{1/3}/[{4\pi^2\gamma \tan(\pi/2-\theta)} {(U_a/U_t)^2-1}]^{1/3}$  (17) ここで、(dV/dt):液体の流量、 $r_e$ :液滴の半径、 $\rho$ :液体の 密度、 $\gamma$ :表面張力、 $\theta$ : Taylor コーン角度の 1/2、 $U_a$ :印加 電位、 $U_t$ :エレクトロスプレーが発生する電位の敷居値、 である.この式から、液体試料の流量 (dV/dt)を小さくす ることで、より微細な帯電液滴が形成されることがわか る.これは、エレクトロスプレーのナノ化で試料検出効率 が上がることに関連する (式 (9) 参照).

探針エレクトロスプレーは、従来エレクトロスプレーを 大幅にダウンサイジングしたことになる.しかし、エレク トロスプレーを究極的にダウンサイジングした現象が古く から知られている.それは、電界脱離 (FD) による気相イオ ンの生成である.

#### 10. 電界脱離 (FD) はエレクトロスプレー現象である

高真空中におかれた鋭利な金属針先端に 10<sup>9</sup> V/m から 10<sup>10</sup> V/m の電場を印加すると,外部から表面に接近する 原子や分子が気相でイオン化されるという現象が発見され た<sup>14</sup>. これが,電界イオン化 (field ionization : FI) であり, 電界イオン顕微鏡の原理である.その後,鋭利な針電極 (エミッター)に直接試料を塗布・乾燥し,これを電場でイ オン化し脱離させる方法が開発された.これが電界脱離 (field desorption: FD)と呼ばれるイオン化法である.これ らのイオン化法は,鋭利なエミッターを利用する点や,真 空中での操作が共通しているので,まとめて議論されるこ とが多い.しかし,イオン化のメカニズムが基本的に異な る,という点に関して指摘されることはまれである.この



Fig. 11. ショ糖と NaClを 2:1 に混ぜた水溶液を 10 μm のタングステン線に塗布・乾燥し、真空下でタン グステン線を加熱して、試料を脱離させたときの 様子. 試料が塗布されたタングステン線の直径は 10 μm、タングステン線への印加電場: 10<sup>8</sup> V/m.

区別をすることがエレクトロスプレーの理解を深めるの で,まず FD について述べる.

Fig. 11 は、ショ糖と NaCl を 2:1 に混ぜた水溶液を直 径 10 µm のタングステン線に塗布・乾燥後, 真空中で試 料が脱離する様子を撮影したものの模式図である<sup>15)</sup>. 10<sup>8</sup> V/m の電場が印加されたタングステン線に電流を流して 加熱し試料に流動性を帯びさせると、図のように試料が隆 起して液柱となり、これが対極に向かって千切れて飛ぶ. この現象は、大気圧下でのエレクトロスプレーにおいて、 キャピラリーに印加する電圧が低いときに、対極に向かっ て大きな液滴が不連続的に出射される現象と似ている.大 部分の試料が失われた後, 電極表面に数多くのミクロな ジェットが観測されるようになる (Fig. 11(e)). この段階 で,ショ糖分子 M の Na<sup>+</sup> 付加体, [M+Na]<sup>+</sup> がマススペ クトル上に観測され始める. この現象は以下のように理解 される. タングステン線の加熱によって試料が流動性を帯 びるにつれて, 試料中のイオン (Na<sup>+</sup> と Cl<sup>-</sup>) が試料中を 電気泳動するようになる. 電場の影響による電気泳動でタ ングステン電極表面に到達した Cl<sup>-</sup> が電極界面で酸化さ れて Cl<sub>2</sub> を生成し (2Cl<sup>-</sup>→Cl<sub>2</sub>), その結果試料が過剰の Na<sup>+</sup> で帯電し、この過剰電荷が表面に蓄積することで流 体が Taylor コーンを形成して、その先端から静電力で [M+Na]<sup>+</sup> が脱離する. これは、まさしく、電気流体噴霧、 すなわち,エレクトロスプレー現象である.ここで注目す るべきは、Taylor コーン先端から、「M+Na<sup>+</sup> が脱離する という実験事実である. これは、10<sup>8</sup>~10<sup>9</sup> V/m の高電場 で、 Taylor コーン先端から [M+Na]+ イオンが直接気相 に脱離したことを示す.5節において、帯電液滴に10<sup>8</sup> V/m の電場が発生した段階で、イオン蒸発機構で気相イオンが 生成すると述べたが、このとおりの現象が起こっている. このような高電場におけるイオンの直接蒸発は、金属イ

オン源からの原子イオン脱離(この場合の電場は~10<sup>10</sup> V/m)に類似した極限的イオンの発生現象である.電界脱 離とは,高電場による Taylor コーン先端からの**イオンの** 脱離現象である.ここで指摘しておかなければならないの は,電界脱離現象は,エミッターからまず中性分子が脱離 (気化)してこれが気相でイオン化されるという2過程の 機構ではないということである.高電場が印加されている 鋭い金属針電極近傍に中性分子があると,この電場にさら された分子は分極されて(誘起双極子),針に向かって引き つけられる.引きつけられて接近する過程で,金属に接触 する前にトンネル過程で金属に向かって電子移動が起こっ て分子がイオン化されるのが以下に述べる電界イオン化で ある.

### 11. 電界イオン化 (FI) と電界脱離 (FD) の メカニズムは異なる

上に述べたように、電界脱離は、静電圧によって凝集相 にあるイオンが気相に脱離する現象である.したがって、 正確には、電界イオン脱離、と呼ぶべきものである.これ に対して、電界イオン化は、鋭利な針電極近傍に近づいた 気体分子が電極に接触することなく、気相においてトンネ ル効果(電子トンネル移動)でイオン化する現象である. Fig. 12(a)は電場が印加されていないときに、分子が金属 表面に接近(吸着ではない)したときの電子のポテンシャ ルエネルギーを表している.IE(イオン化エネルギー)は 分子の最高被占軌道と真空準位とのポテンシャルエネル ギーの差に相当する.分子の最高被占軌道は金属のフェル ミ準位よりも低いので(より安定)、分子と金属間での電子 のやり取りは起こらない.なぜなら、金属の価電子帯の電 子準位は電子対で充たされているからである.

ここで、金属に正の高電圧を印加すると、金属表面近傍 のポテンシャルが Fig. 12(b) のように右上がりとなり、分 子の最高被占軌道のエネルギー準位が引き上げられる。電 場を E、金属表面から分子までの距離を x とすると、x と E の積、 $[x \times E]$  の値がちょうど  $[IE - \Phi]/e$  になった距離 で、金属のフェルミレベルと分子の最高被占軌道が一致す る. このときの臨界接近距離を x<sub>c</sub> とすると、

$$e[x_c \times E] = IE - \Phi \tag{18}$$

となる.式(18)のエネルギーの単位は eV である.ある一定の電場 E が印加された状態で,  $e[x_c \times E] \ge IE - \phi$  が成り 立つ条件,すなわち,分子が金属表面より  $x_c$ 以上離れてい れば,分子の最高被占軌道の準位がフェルミ準位よりも高 くなるので,分子の最高被占軌道の電子が金属の伝導帯 (電子が占有されていない空準位帯)にトンネル移動(図の 障壁を透過)してイオン化される(電界イオン化)過程が 起こりうる.生成した正イオンは,電極近傍の正電場のた めにクーロン反発力によって対極に向かって飛び去る.こ こで注意しなければならないのは,接近距離が  $x_c$ よりも 小さいと,  $e[x_c \times E] < I - \phi$ となるので,トンネル電子移動 は起こらないという点である.また,遠すぎるとエネル ギー障壁が高くなって,トンネルイオン化確率が下がる.



Fig. 12. 電界イオン化のメカニズム. (a) 電場なし, (b) 高
 電場印加. IE: 分子のイオン化エネルギー, Φ: 金
 属の仕事関数, x: 金属表面からの距離. x<sub>c</sub>: e[x<sub>c</sub>×
 E]=IE-Φ となる臨界距離.

 $x_c$ の値は, *E*, *IE* および  $\phi$ の値に依存する.  $E=10^{10}$  V/m では,数ないし十数 Å (1Å=10<sup>-10</sup> m) と見積もられる.電 界イオン化で生成するイオンは,電子を失ったラジカルイ オンとなる.トンネル電子移動による電界イオン化の過程 では,イオンの内部エネルギー励起が起こりにくいので, 極めてソフトなイオン化が起こる.フラグメントイオンは ほとんど生成しない.

"中性"分子が正電位の金属電極に接近して高電場にさ らされると、強い電場の作用によって分子が金属に向かう 静電作用力を受ける.これは、分子の永久双極子モーメン ト,あるいは電場によって誘起される誘起双極子モーメン トに起因する. このため、中性分子は、表面に引きつけら れて吸着する(電界吸着).このような現象で、電極表面が 汚染されやすい.また、気相での電界イオン化が起こると、 イオン化で生じた電子が金属表面を衝撃して、表面に吸着 した分子を解離させたりイオン化したりするなど、複雑な 現象が起こる.また、金属電極上に吸着した絶縁物の厚さ が xc 以上になると、絶縁物表面の分子がトンネルイオン 化されて脱離するという現象も起こりうる. このため、ラ ジカルイオンのほかに、プロトン化された分子の生成も起 こりうる(固体表面におけるイオン分子反応). 有機化合物 などの電界イオン化では、このような複雑な現象が絡み 合って進行するので、電極の汚れをできるだけ防ぐ必要が ある.

### 12. MALDIでは一価イオンしか観測されないのに, ESIで多価イオンが観測されるのはなぜか?

MALDIでは、マトリックスが大きな吸収をもつ紫外 レーザー光(窒素レーザー: 337 nm, YAG レーザー2倍 波: 355 nm など)、あるいは赤外レーザー光をマトリック スに照射し、分析種をイオン化・脱離させる.マトリック ス分子が多光子吸収などによって電子・振動励起され、マ トリックス由来の励起種や反応イオンが生成する.マト リックス分子のイオン化では、正イオンと電子あるいは負 イオンが対で生成する.生成した反応イオンが分析目的成 分と反応してこれをイオン化する.反応イオンはもともと 1価イオンなので、分析種の多価イオンは生成しにくい. マトリックスがレーザー光を吸収してから数十 ns 経過し てようやくマトリックスのアブレーションが始まる.発生 するプルームは高密度のプラズマ状態になっており,正イ オンと電子あるいは負イオンとの再結合が起こりやすく, またアブレーションに伴って生成する微粒子に分析目的成 分が取り込まれるなどの理由で,分析対象分子のイオン化 率は低くなる.これより,MALDIで検出される試料イオ ンは,千載一遇のチャンスで生き残った"lucky survivor" とたとえられる<sup>16</sup>.それにもかかわらず,マトリックスが, ①分析種をイオン化し,さらに②アブレーションを起こし て生成したイオンを気相に脱離させる,という巧妙なメカ ニズムが働くので(マトリックスの一人二役),条件を適切 に設定することで,ピコモルは元よりフェムトモルオー ダーの試料検出も難しくない.マトリックス中に試料分子 が多価イオンとして存在している場合 (preformed ion), これがマトリックスのアブレーションで気相に脱離して, 多価イオンが観測されることもある.

エレクトロスプレーでは、キャピラリー先端で起こる電気化学反応によって、先端部の液体に過剰電荷が供給・蓄積される. たとえば、水溶液試料における正イオンモードでは、金属界面で起こる水の酸化反応、 $2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^{-}$ (Table 1)などで、先端液体に過剰のプロトンが付与される. 過剰電荷で帯電した液滴の噴霧は、Rayleigh "極限"現象である. 帯電液滴に付与された過剰電荷は、ペプチドやタンパク質分子に付加して、多価イオンとして観測される. 過剰イオンが電気化学 "反応"によって能動的にRayleigh 極限に至るまで液滴に供給される、というメカニズムがエレクトロスプレーの特徴である. この特徴をいかに有効に活かすか、がエレクトロスプレーを応用するうえで重要となる.

ここで、エレクトロスプレーで発生する帯電液滴中の過 剰電荷の濃度を見積もってみる.従来エレクトロスプ レー、ナノエレクトロスプレーでは、ともに数十 nA から 数百 nA 程度の電流が流れる.探針エレクトロスプレーに おいても、スプレー開始後、数十 nA の電流が観測され  $る^{9}$ .エレクトロスプレー電流値が *i* (Fig. 1 における TDC)の場合に、帯電液体中の過剰電荷のモル濃度 [*Q*] は 以下の式で与えられる<sup>17</sup>).

$$[Q] = i/F\Gamma \tag{19}$$

ここで, [Q] の単位は mol/L, *i* はエレクトロスプレー電 流 (A: C/s), *F* は Faraday 定数 (96,500 C/mol), *F* は液体 試料の流量 (L/s) である. エレクトロスプレーにおける電 流量 *i* (C/s) は, ESI, nanoESI, 探針エレクトロスプレー でそれほどの大差はない. したがって,式(19)から,過剰 電荷の濃度 [Q] は,粗い近似で液流量 *F* に反比例するこ とがわかる. エレクトロスプレーのナノ化で,試料の検出 効率が上がる理由がここにある (式(17)参照). 通常のエ レクトロスプレーでは [Q] の値は~10<sup>-5</sup> M 程度とな る<sup>17)</sup>. ナノエレクトロスプレーや探針エレクトロスプレー の場合における [Q] を大雑把に計算すると, 10<sup>-3</sup> M から 10<sup>-2</sup> mol/L 程度にもなる. この高い過剰電荷濃度がナノ エレクトロスプレーや探針エレクトロスプレーの高感度能 を説明する (分析目的成分が過剰電荷でイオン化されやす い). エレクトロスプレーで多価イオンが生成しやすいこ とがうなずける.

#### 13. エレクトロスプレーの応用例

市販の質量分析装置のエレクトロスプレーの多くは直交 エレクトロスプレー型,すなわち,イオンサンプリングオ リフィスの軸に対して直角に気送支援エレクトロスプレー を吹き付ける方式を採用している.筆者はこの配置が最も 強いイオンシグナルを与えることを偶然見いだし,1995 年に公表した<sup>18),19)</sup>.その1年後,この論文が*Anal. Chem.* 誌の News & Features 欄に取り上げられ<sup>20)</sup>,その後,直交 エレクトロスプレー方式を基本とするエレクトロスプレー インターフェイスが多くの装置メーカーによって市販され るようになった.

既述したように、従来エレクトロスプレーではナノエレ クトロスプレーに比べて過剰電荷の供給効率が低く、気相 イオンの生成に寄与しにくい大粒の帯電液滴が多く発生 し、イオン源電極を激しく汚染する. 大粒の液滴はエレク トロスプレープルームの中心部に分布しやすいので、エレ クトロスプレーを直交型にすることで、これらをサンプリ ングオリフィスの上方を素通りさせて真空装置への流入を 抑えることができる<sup>21)</sup>.帯電液滴の分裂で生成した微細な 二次液滴や気相イオンは、主にエレクトロスプレープルー ムの外側に分布しやすい. これは,同一符号電荷をもつ帯 電液滴の集合体であるエレクトロスプレープルーム中に発 生する空間電荷電場 (space charge field) により、 質量の より小さい液滴や気相イオンがプルームの外側に向かって より早く拡散移動しやすく、逆に大きな液滴は中心部に残 るからである18). したがって, 直交型エレクトロスプレー 方式で,大粒の液滴を排除し,プルーム周辺に多く分布す る気相イオンを選択的に真空にサンプリングすることがで きる. 直交エレクトロスプレーは、数 µL/min 程度の流量 を取り扱う場合の対処法であるが、エレクトロスプレーを ナノ化すれば、電極の汚染は大幅に軽減され、また試料の イオン化効率も上がる. したがってナノエレクトロスプ レーでは、直交型サンプリングの必要性は低くなり、ネブ ライザーなしでの平行スプレーでなるべく多くのスプレー プルームを質量分析装置の真空側にサンプリングすること で、イオン強度の増大を図ることができる.

レーザー光は、焦点を絞ることで高密度の光子を微小領 域に照射できるので、物質に瞬時に高エネルギーを与えて 非線形的な現象を引き起こすことが可能となる. MALDI がその典型である.筆者らは、レーザーの集光性を活かし つつ、しかし弱いパワーを用いてアブレーションを起こさ せずに穏やかに Taylor コーンを加熱する "赤外レーザー 支援" エレクトロスプレー法,略して、レーザースプレー イオン化法、を開発した<sup>22)</sup>.

Fig. 13 に、ミオグロビンの水溶液試料が流出するステ ンレス鋼キャピラリー先端に 0.3 mm 程度に絞った 10.5  $\mu$ m の赤外レーザー光を照射したときの Taylor コーンの 変化を示す.



Fig. 13. 赤外レーザー光を照射したときのマススペクトル と Taylor コーンの変化. 試料: 10<sup>-5</sup> M のミオグ ロビン水溶液. (文献 22 より許可を得て改変. ©2005, Elsevier Science Limited).

レーザーパワーの増加で水溶媒の気化が促進され, Taylor コーンのサイズが急速に小さくなり、2W でキャ ピラリー先端すれすれまで縮小する. このときのレーザー パワー密度は、数 10<sup>4</sup> W/cm<sup>2</sup> である.赤外レーザー照射 で水溶媒が効率よく気化するのは、水が波長 10.6 µm 領 域に大きな吸収をもつからである. この波長における吸収 係数は 1,000 cm<sup>-1</sup> なので、赤外光の浸入深さは、10<sup>-3</sup> cm,約10µm 程度となる.つまり、10.6µm の赤外光は、 波長オーダーの薄い表面層に吸収されて、効率よく水溶液 表面近傍のみを局部的に加熱・気化させる. Fig. 13 にお いて、レーザーパワーの増加に伴って、シグナル強度も増 加していくことがわかる. この実験では赤外光を吸収しや すいステンレス鋼キャピラリーを使用しているので、2 W を超えると、キャピラリー先端が加熱のために劣化しやす くなり、加熱されたキャピラリー先端部で水溶液試料が突 沸し始めて試料が液滴として飛散し, シグナル強度が下が る. このような突沸現象は金キャピラリーを用いることで 大幅に抑制できる. これは、金が赤外光を反射しやすいの で金キャピラリー自身が加熱されにくく、流出する水溶液 に集中的に光エネルギーを投入することができるからであ る.金キャピラリーを用いると、水溶液試料のシグナル強 度がレーザー照射前のエレクトロスプレーに比べて1桁 以上増大することさえある23).

エレクトロスプレーは、一般に水溶液を苦手とするが、 レーザースプレーイオン化法は、とくに水溶液試料に向い ている. Fig. 13 に示すように、赤外レーザー照射で、エレ クトロスプレー発生が容易になり、生成する液滴のサイズ も明らかに微細化する. なぜこのような現象が起こるので あろうか. これを明らかにするために、筆者らは、レー ザー照射の有無におけるエレクトロスプレー電流(Fig. 1 の TDC)を測定した. その結果、レーザー照射で若干電流 量が増加したものの、大差は認められなかった.赤外レー ザー照射で水溶媒の多くが気化する(Fig. 13 の写真). こ れによって実質的な試料の流量が大幅に減少する. エレク トロスプレー電流がほとんど変化しない、ということは、 電気化学反応によって供給される過剰電荷が水溶媒が気化 した分だけ帯電液滴中に濃縮されることを意味する. それ と同時に、試料も濃縮される. この相乗効果で、イオンシ グナル強度が増大する結果となる. レーザースプレーイオ ン化法は、エレクトロスプレーに赤外レーザー光を照射し て実質的に流量を減らす、つまりエレクトロスプレーのナ ノ化を行っているようなものである(9節参照).

Fig. 13 のマススペクトルから,レーザーパワーが 1.6 W から 1.8 W になると,突然ミオグロビンが変性を起こして,ヘムを放出したアポミオグロビンが生成することがわかる.これは,レーザー照射されて加熱された液相中でミオグロビンが熱変性を起こしたことを示す.このように,レーザースプレーでは,液相中でのタンパク質の熱変性過程を容易に追跡できる.

また,レーザースプレーは,とくに非共有性複合体の解離過程の観測に適していることがわかった<sup>24)~27)</sup>.一例として,Fig. 14 に二重鎖 DNA と薬物複合体の分析例を示す<sup>27)</sup>.

レーザーパワーの増加で,複合体が解離して一重鎖 DNA とその薬物複合体への解離が観測されている. この マススペクトル変化は、レーザーパワーを on-off 調節す るだけで観測できるので,測定時間は1分もあれば十分 で,迅速性が特徴である<sup>25)~27)</sup>.

非共有性結合体は生命活動において極めて重要な役割を





(文献 27 より許可を得て転載. ©2008, the Mass Spectrometry Society of Japan).

果たしている. たとえば, DNA と染色体においては, 二重 鎖 DNA, DNA とヒストン, ヒストン(複数タンパク質分 子の複合体)、クロマチンの折りたたみ構造体、これらすべ ての構造が非共有性結合によって保たれている. 生命現象 は、このような非共有性複合体をほどいたり、再構成した り、構造をフレキシブルに変化させたりして、巧妙に生命 活動を維持している. このように,非共有性複合体の反応 や安定性を知ることは生命現象を解明することにつなが る. 生命体においては、細胞内でのタンパク質合成などの 反応が非共有性複合体などの働きで極めて速い速度で起 こっている.非共有性複合体は,たとえば二重鎖 DNA の 塩基対のように、局部の結合は、水素結合エネルギー程度 ではあるが、この弱い結合が分子全体として作用している ので、総和として複合体全体では非常に強い結合が形成さ れていることになる. それにもかかわらず, 生体中での非 共有性複合体はわれわれの想像を超える速度で反応し, 生 命活動を維持している. たとえば、細胞1個で、1秒間に 数万個ものタンパク質が合成されている. このような速い 反応が可能なのは、非共有性複合体がほどけたり、また元 に戻る反応が迅速に起こることを示す. このような早業が 可能なのは、水溶媒のおかげである.非共有性複合体が解 離する際、サブユニットが直ちに水和されて安定化される ので,解離反応の前後でのエネルギー差が小さくて済む. 水がなければ高等な生命活動は維持できない. 質量分析に おいて,非共有性複合体を真空中で衝突誘起解離させて, 解離過程を観測することが行われている. このような真空 下における解離では、水溶媒が存在しないので、複合体に 大きな運動エネルギーを与えないと解離しない. ややもす ると、サブユニットの共有結合の切断さえ起こる.また、 真空中での非共有性複合体の解離のメカニズムは、水溶液 中とは異なるという指摘もある28). これは、真空中での解 離にはサブユニットの水和が伴わないので十分予想される ところである. この点からも, 液相中での非共有性複合体 の解離が観測できるレーザースプレーイオン化法はユニー クである.

エレクトロスプレーは、数十ないし数百nAのイオン発 生銃のようなものである。発生させたイオンを反応イオン として利用する種々の応用例が開発されている。エレクト ロスプレーを open-air で発生させると、大気中の微量成 分、とくにプロトン親和力の大きな気体成分が検出される ことがままある。これは、エレクトロスプレーで生成した イオンによって、大気中の不純物分子がイオン分子反応に よってイオン化されるからである。不純物によるマススペ クトルの汚染を防ぐためには、エレクトロスプレーイオン 源を清浄な窒素ガスで充たすなどの工夫が必要である。一 方、エレクトロスプレーで発生させたイオンを反応イオン として積極的に利用する試みが多数登場してきた。たとえ ば、エレクトロスプレーを呼気や、検体からの発生蒸気に 吹き付けることで、気体成分が分析できる<sup>29</sup>.

Shiea らは、生体組織などにレーザー光を照射して、これによって発生する蒸気成分をエレクトロスプレー雰囲気



(文献 31 より許可を得て改変. ©2004, the American Association for the Advancement of Science).

に導入して、イオン化する方法を開発した<sup>30)</sup>.また、 Cooks らは、メタノール溶媒を用いたナノエレクトロスプ レーを直接固体試料に吹き付けて、固体試料に含まれる成 分をメタノールで部分的に溶解し、さらにエレクトロスプ レー気流で脱離・イオン化させる方法、DESI (desorption ESI)、を開発した<sup>31)</sup> (Fig. 15).

この方法は、生体試料、植物、薬剤、爆発物、などの固体試料に普遍的に適用可能な方法である. エレクトロスプレーをナノ化しプルームサイズを 150 µm 程度まで絞り込むことで、指紋を直接イメージング像として観測することにも成功している<sup>32</sup>.

これらのエレクトロスプレー応用技術において、エレク トロスプレーに供給するべき分析対象試料の量は、電流換 算で、エレクトロスプレー電流以下で十分である.これ以 上の量の試料をエレクトロスプレー内に供給しても、エレ クトロスプレー内のイオン量が相対的に少ないので、導入 された余分な試料分子はイオン化されず無駄になる.した がって、エレクトロスプレーを反応イオン源として利用す るうえでのコツは、エレクトロスプレー電流に見あった微 量試料をプルーム内になるべく効率よく導入することであ る.たとえば、DESIでは、スプレーされる固体試料が吹き 付けられる液体でわずかに湿る程度、という微妙な調整が なされている.最近開発された大気圧下での表面質量分析 に関しては、van Berkel らの文献が詳しい<sup>33</sup>.

エレクトロスプレーは古くから,静電塗装や薬剤噴霧な どに使われてきた.塗布される対象物が絶縁性の場合,表 面がしだいに帯電してエレクトロスプレーが不安定にな る.このような問題点を防ぐためには,キャピラリーへ交 流電圧を印加することで,正および負イオンモードのエレ クトロスプレーを交互に発生させて対象物に吹き付けると いう方法が考えられる.エレクトロスプレー発生には,電 気化学反応によって,液体を十分な過剰電荷で帯電させる だけの"誘導時間"が必要である.このため,正イオンモー ドと負イオンモードを交互に発生させるためには,交流の 正~負の電圧極性変換サイクルの間に,Rayleigh極限に 至るまで正・負の過剰電荷量を液滴に溜めこむ必要があ る.エレクトロスプレー発生のための誘導時間は条件に よってさまざまであるが,60 Hz の高電圧印加で正・負エ レクトロスプレーを交互に発生させた研究例が報告されて いる<sup>34)</sup>.

#### 14. 結 語

エレクトロスプレーという現象は、キャピラリー先端あ るいは探針の表面(金属と液体の界面)で起こる電気化学 反応に起因することを述べた. 電気化学反応によって, 過 剰電荷がキャピラリー(あるいは探針)をぬらしている液 体の表面に供給される. すなわち, エレクトロスプレーで は、キャピラリーあるいは探針が半電池として働く. エレ クトロスプレーを発生させるには、キャピラリー(あるい は探針)と対極の間に通常数 kV を印加する必要がある. これに対して,水の電気分解では,陽極と陰極の間に 10 V 以下の電圧をかけるだけで電気化学反応が起こる (両金属電極の表面からの気体の発生). なぜ, エレクトロ スプレーでは、キャピラリーと対極の間に kV オーダーの 高電圧を印加する必要があるのか? それは、数 kV の電 位を印加しないと、キャピラリーあるいは探針表面での電 気化学反応が進行しないからである. 電気化学反応が起こ る前の状態では、金属表面に接する液体に強い電場がかか る. そして, これが電気化学反応を誘起する. 電気化学反 応の進行とともに過剰電荷が液体に供給されて、これらの 過剰電荷が液体表面に凝集し始めると、金属表面近傍の液 体にかかっている電場強度がしだいに弱まり、電気化学反 応の速度が小さくなっていく. 電気化学反応によって液体 表面に供給される過剰電荷の表面密度が Rayleigh 極限を 超えると、エレクトロスプレーが発生する.

10 V 程度以下の電位差で起こる電気分解反応において も、エレクトロスプレーと同様に電極表面近傍で、10の何 乗 V/m という電場がかかる. これは、電気化学反応に関 与する液層の厚さ(電気二重層)が、極めて薄いからであ る (Debye 遮蔽長オーダー, 数十 nm 以下). これより, エ レクトロスプレーを利用して試料の検出感度を向上させる には、金属電極上の液体試料の厚さをできるだけ薄くし て、さらに、この薄い領域にできるだけ大きな電場を印加 させることが望ましいことがわかる. こうすることで, よ り微細な、すなわちより高電荷密度の帯電液滴が生成でき る. 探針エレクトロスプレーは、この考え方の大気圧下実 験での一つのソリューションである.また,電界脱離現象 は、エレクトロスプレーの究極を実現している. これは、 電界脱離現象が放電の心配がない高真空下で行えるので, 10<sup>8</sup> V/m 以上の高電場を印加できるからである. このた め、電界脱離ではシングルイオンさえ固相から気相に脱離 させることが可能となる.

#### 文 献

- 1) R.A. Serway, "科学者と技術者のための物理学", 松村博 之訳, 学術図書出版社, 東京.
- 2) P. Kebarle and L. Tang, Anal. Chem., 65, 972A (1993).
- M. S. Wilm and M. Mann, Int. J. Mass Spectrom. Ion Process., 136, 167 (1994).
- I. Marginean, L. Parvin, L. Hefferman, and A. Vertes, Anal. Chem., 76, 4202 (2004).
- 5) "Electrospray Ionization Mass Spectrometry," ed. by

R. B. Cole, John Wiley & Sons, Inc., New York (1997).

- G. J. van Berkel, K. G. Asano, and P. D. Schnier, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 12, 853 (2001).
- K. Hiraoka, K. Nishidate, K. Mori, D. Asakawa, and S. Suzuki, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 21, 3139 (2007).
- L. C. Chen, K. Nishidate, Y. Saito, K. Mori, D. Asakawa, S. Takeda, T. Kubota, N. Terada, Y. Hashimoto, H. Hori, and K. Hiraoka, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 22, 2366 (2008).
- L. C. Chen, K. Nishidate, Y. Saito, K. Mori, D. Asakawa, S. Takeda, T. Kubota, H. Hori, and K. Hiraoka, J. Phys. Chem. B, 112, 11164 (2008).
- 10) K. Hiraoka, L. C. Chen, D. Asakawa, S. Takeda, and T. Kubota, J. Surf. Anal., 15, 279 (2009).
- L. C. Chen, K. Yoshimura, Z. Yu, R. Iwata, H. Itoh, H. Suzuki, K. Mori, O. Ariyada, S. Takeda, T. Kubota, and K. Hiraoka, *J. Mass. Spectrom.*, 44, 1469 (2009).
- 12) S. N. Jackson, M. Ugarov, T. Egan, J. D. Post, D. Langlais, J. A. Schultz, and A. S. Woods, *J. Mass Spectrom.*, 42, 1093 (2007).
- S. Taira, Y. Sugiura, S. Moritake, S. Shimma, Y. Ichiyanagi, and M. Setou, *Anal. Chem.*, 80, 4761 (2008).
- E. W. Müller, Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften, 27, 290 (1953).
- 15) S. S. Wong, U. Giessmann, M. Karas, and F. W. Röllgen, Int. J. Mass Spectrom. Ion Process., 56, 139 (1984).
- M. Karas, M. Glückmann, and J. Schäfer, *J. Mass Spectrom.*, **35**, 1 (2000).
- 17) T. L. Constantopoulos, G. S. Jackson, and C. G. Enke, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 10, 625 (1999).
- K. Hiraoka, H. Fukasawa, and K. Aizawa, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 9, 1349 (1995).
- 19) M. A. Niessen, J. Chromatogr. A, 794, 407 (1998).
- 20) K. Hiraoka, Anal. Chem., 68, 81A (1996).
- 21) J. H. グロス, "マススペクトロメトリー", 日本質量分析学 会出版委員会訳, シュプリンガー・ジャパン, 東京 (2009).
- A. Takamizawa, S. Fujimaki, J. Sunner, and K. Hiraoka, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 16, 860 (2005).
- 23) A. Takamizawa, H. Maeda, S. Kambara, H. Furuya, and K. Hiraoka, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 22, 2453 (2008).
- 24) X. Shi, A. Takamizawa, Y. Nishimura, K. Hiraoka, and S. Akashi, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 22, 1430 (2008).
- 25) X. Shi, Y. Nishimura, S. Akashi, A. Takamizawa, and K. Hiraoka, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 17, 611 (2006).
- 26) X. Shi, A. Takamizawa, Y. Nishimura, K. Hiraoka, and S. Akashi, J. Mass Spectrom., 41, 1086 (2006).
- 明石知子, 史 向国, 高見沢 淳, 西村善文, 平岡賢三, J. Mass Spectrom. Soc. Jpn., 56, 155 (2008).
- 28) L. P. Benesch, F. Sobott, and C. V. Robinson, Anal. Chem., 75, 2208 (2003).
- H. Chen, A. Wortman, and R. Zenobi, J. Mass Spectrom., 42, 1123 (2007).
- 30) J. Shiea, M. Z. Huang, H. J. Hsu, C. Y. Lee, C. H. Yuan, I. Beech, and J. Sunner, *Rapid Commun. Mass Spectrom.*, 19, 3701 (2005).
- 31) Z. Takáts, J. M. Wiseman, B. Gologan, and R. G. Cooks, *Science*, **306**, 471 (2004).
- 32) D.R. Ifa, N.E. Manicke, A.L. Dill, and R.G. Cooks, *Science*, **321**, 805 (2008).
- 33) G. J. Van Berkel, S. P. Pasilis, and O. Ovchinnikova, J. Mass Spectrom., 43, 1161 (2008).
- 34) 金丸真広, 横山奈津子, 足立元明, J. Aerosol Res., 21, 233 (2006).

*Keywords*: Electrospray, Probe electrospray, Laser spray, Field desorption, Field ionization